PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-165311

(43) Date of publication of application: 11.06.1992

G02B 6/12 (51)Int.CI. **G02B** 6/00

G02B 6/18

(71)Applicant : BROTHER IND LTD (21)Application number: 02-292947

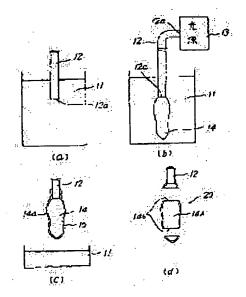
(72)Inventor: IWASAKI TAKAO 30,10,1990 (22)Date of filing:

(54) MANUFACTURE OF PHOTO WAVEGUIDE PASSAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a refractive index distribution type photo waveguide passage through the low number of processes with a high yield by immersing the emission end of an optical fiber in a photo curable material, waveguiding light through an optical fiber to form a cured part at an emission end, and polishing the cured part to an end part.

CONSTITUTION: When, after an emission end 12a of an optical fiber 12 is im mersed in light transmissive photo curable resin 11, the incident end of the optical fiber 12 is irradiated with ultraviolet rays from a light source 13, the photo curable resin 11 in the vicinity of the emission end 12a is started to cure and finally forms a cured part 14. The cured part 14 is taken out from the uncured photo curable resin 11 together with the optical fiber 12. After the uncured photo curable resin 11 is washed, the surface thereof is coated with light transmissive resin 15 having a refractive index lower than that of the photo curable resin 11. Cutting



and grinding are applied on a cured part 14A, formed by cutting the cured part 14 from the optical fiber 12, by a cutting and a grinding means to form an end surface 14b. This method simplifies provi sion of a refractive index distribution type photo waveguide passage 20.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑩日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

平4-165311 @ 公 開 特 許 公 報(A)

Mint. Cl. 5

識別記号

母公開 平成4年(1992)6月11日

G 02 B 6/00

6/18

M 366

7036-2K 7036-2K 7036-2K

庁内整理番号

未請求 請求項の数 L (全4頁) 審查請求

60発明の名称。

光導波路の製造方法

平2-292947 頣 印特

の出 飅 平 2 (1990)10月30日

明 者 促発

岳

愛知県名古屋市瑞徳区堀田通9丁目35番地 ブラザー工業

株式会社内

ブラザー工業株式会社 る。

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

外1名 弁理士 石川 泰男 *9*10 理

1. 発明の名称

光導波路の製造方法

2. 特許請求の範囲

光硬化性材料中に光ファイバの出射端を浸す第 1工程と、

前記光ファイバ中に光を導波させ前記出射端か ら出射させることにより前記光ファイバの出射機 に前記光硬化材料による硬化部を形成する第2工

前記硬化部を研磨して増配を形成することによ り光導波路を作成する第3工程と、 を備えたことを特徴とする光等波路の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光伝送路として光書き込み装置や光 氏み取り装置又は光回路等に用いられる光導波路

の製造方法に関する。

[従来の技術]

従来、この種の屈折率分布型光導波路もしくは 屈折串分布型ロッドレンズの製造方法としては、 次に説明する方法があった。

即ち、ガラス様を溶融塩に長時間浸渍すること により、あらかじめガラス中にドープした電子分 極率が大きく高温でガラス中を移動しやすい一番 イオンを、前記海融塩中のアルカリイオンと交換 する。その結果生じるイオン拡散分布の飲物級近 似性を利用して導致路又はレンズ状媒質に必要な 屈折率分布を形成する。次いで、切断、研修によ って必要な位置に韓面を形成して専円筒状の形状 に形成することによって、屈折率分布型光導波路 もしくは屈折本分布型ロッドレンズを得るという 製造方法である。

(発明が解決しようとする課題)

・しかしながら、前述のごとき製造方法を用いて 光伝送路としての光導波路を得るには、工程数が 多く、また歩どまりが良くないという問題点があ った。

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、少い工程数で、歩智りよく屈折本分布型の光導波路を得ることができる光導波路の製造方法を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)

この目的を連成するために本発明の光導波路の 製造方法は、光硬化性材料中に光ファイバの出射 増を浸す第1工程と、前記光ファイバ中に光を導 波させ前記出射端から出射させることにより前記 代表を形成する第2工程と、前記硬化 総を研磨して 建 部を形成することにより光導波路を作成する第3工程と、を備えた。

(作用)

本発明によれば、第1工程で、光硬化材料中に 光ファイバが浸される。第2工程で浸された光ファイバの出射端から光が出射されるが、この出射 光の光パワ密度分布に従って光硬化性材料が分子 量分布をもって硬化される。すなわち、この分子

的にはエスカCK・10(商品名、三菱レイヨン 社製、直径250μm、閉口角30°)を用いた。 次いで、第1図(b)に示すように、光ファイ パ12の入射端126へ光源13より乗外線を入 射する。無外線は、光ファイバ12中を導波され 出射端12aより前口角度30°で出射される。 これによって出射端12a付近の光硬化性樹脂 11は硬化を開始し、最終的には図に示すモスク 型の形状を有する硬化部14となる。出射端 12点から出射される紫外線のパウを波長360 ■mで300μWであるとすると、本光硬化性樹脂 は約5秒で数に示される形状を有する硬化部14 となった。硬化部14は、幅が1,2mで長さは 8. 5mであった。また、硬化部14は、後述の 如く中心軸から放射状に屈折率分布を有するため、 硬化郎14単体で光導波構造を育する。

次に、第1回(c)に示すように、硬化部14を光ファイバ12ごと未硬化の光硬化岩部11から取り出し、表面に残留している未硬化の光硬化樹脂11を洗い洗した後、表面に光硬化樹脂11

量分布が屈折率分布となって先の導致構造となる。 第 3 工程で、前記硬化配を研磨して光準波路を作 成する。

(実施例)

以下、本発明を具体化した実施例を図面を参照 して説明する。

以下、頭を迫って光導波路の製造方法における 工程を説明する。第1図 (*a) ~ (d) は、本発 明に係る光導波路の製造方法を示す。

先ず、第1図(a)に示すように、透光性の光 硬化性樹脂11中に、光ファイバ12の出射館 12aを浸す。光硬化性樹脂11としては無外線 硬化性樹脂を用い、例えば、ファ素モノマー。 (光反応開始剤)を混入マーにイニシェ 挙げる れる。具体的には、ファ素系モノマーがある しefensa 479・18(商品新工1.512、 で化学工業社製、硬化剤の固折率1.512、 では、プラスチック先ファイバを用い、具体

より更に担折率の低い過光性樹脂15をコーティングする。過光性樹脂15には、硬化郎14の表面を腹や傷から保護し、強度を上げる効果の他に、硬化郎14に入射された光ビームが散乱等の原因で劇面14aより漏れ出てしまうのを使力防止する効果がある。前記透光性樹脂15の具体例としてPMMA(鼠折率1.49)等が挙げられる。

次に、第1図(d)に示すように、光ファイバ12から硬化部14を切り離して硬化部14人とし、この硬化部14人に切断、研削等の手段を用いて表面相さり、01μm以下程度の増面14bを形成することにより円筒形状に加工し、最終的な屈折率分布型の光導波路20を得る。

次に、第2図(a)~(c)を用いて前述の硬化割14の形成状況を時間を追って設明する。

第2図(a)に示すように、光ファイバ12から紫外線21が30°の角度(閉口角)をもって光硬化性樹脂11中に出射される。このとき、紫外線21の光パワ密度分布22は、光ファイバ12の光蚰延長線23上を最大値とする2次元が

ウス分布を示し、光硬化性樹脂 1 1 は、この光パワ密度分布 2 2 に従ってパワの強い配位から序々に硬化を開始する。図中には無外線 2 1 の経路が 矢印をもって示されている。

次いで第2図(b)に示すように、光帕延長線23上は無外線21のパワ密度が一番高い部位であるから、光硬化性樹脂11は、まずこのパワ密度が一番高い部位からポリマー化され硬化する。この現象は、分子量が大きくなって風折率が高くなることと等しい。

以上の作用によって光軸延長線23から放射状に屈折率分布が形成されるため、光ファイバ12の出射端12aより30°の角度で拡がって出射された無外線21は、その光路を屈折率差により内側に曲げられて速むようになることが観察された。

次いで、第2回(c)に示すように、ポリマー 化された光硬化性樹脂11が光軸延長線23から 放射状に屈折率分布を有しているため、無外線 21は光軸延長線23に沿って図の矢印に示され

なお、本発明は、上記の実施例に限定されるものではなく適宜変更を加えることが可能である。 例えば、第1図(c)に示される透光性樹脂のコゴティング工程を省くことによっても同様な光導 波路を得ることができる。

また、光準波路の周折率分布を中心軸から半径 方向の距離を r として

$$n(r) = n (1 - \frac{A}{2} r^{2})$$

n a : 中心軸上での屈折率

A : 屈折率分布定数 で示されるように構成することによって屈折率分 布型ロッドレンズを得ることも可能である。

(発明の効果)

以上詳述したことから明らかなように、本発明によれば、少い工程数で歩止りよく屈折率分布型の光導波路を得ることができるという効果を奏す。

次に、第3回を用いて光導表路20の動作を設明する。

光導波路 2 0 の入射性 2 0 。に入射された光ビーム 3 0 は、光導波路 2 0 のもつ中心軸に対する放射状の屈折率分布に従って光導波路 2 0 中を図中矢印で示したように蛇行しながら進行し、出射端 2 0 b から関ロ角 1 5 . 2 ° で出射される。このため低損失で良質な光導波路となり得る。

4. 図面の簡単な説明

第1団(a)~(d)は、木発明の製造工程を 示す図、

第2四(a)~(c)は、光硬化性材料の硬化 状況を示す図、

第3回は、本発明の動作説明図である。

- 11…光硬化性材料
- 12…光ファイバ
- 1 4 … 硬化部
- 15… 选光性材料

出願人代理人 石 川 拳 男

